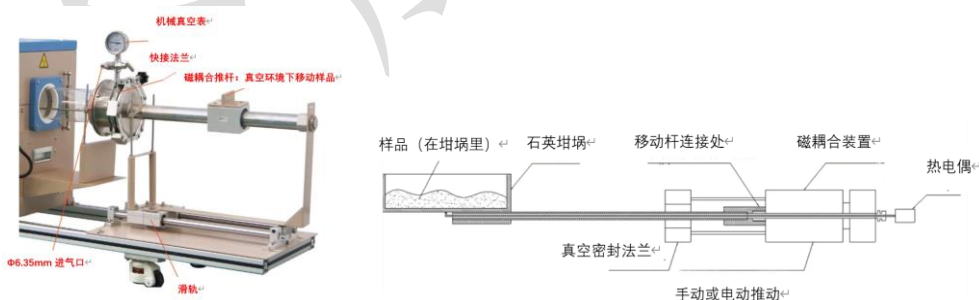




1200°C高真空管式炉（炉管内径Φ75mm,样品可真空环境移动） OTF-1200X-DVD-M






OTF-1200X-DVD-M 是一款高真空管式炉，此款管式炉可在真空或气氛保护环境下移动样品坩埚（手动推动）。这种真空密封的手动推杆坩埚是通过一个磁耦合真空推杆系统实现的。这款设备可在各种气氛或真空下实现样品的快速加热，HPCVD，快速热蒸发（RTE）和直接气相沉积（DVD）

技术参数

产品特点

· 通过磁耦合驱动，坩埚在真空/气氛环境中实现移动。



	<ul style="list-style-type: none"> · 通过坩埚底部的热电偶进行实时温度测量。 · 左侧端的法兰采用快接法兰，便于取放样品。 · 高真空密封,真空度可达 10^{-5}Torr
电源	<ul style="list-style-type: none"> · AC208~240VAC, 单相, 50/60Hz
工作温度	<ul style="list-style-type: none"> · 最高工作温度: 1200°C (< 30 分钟) · 连续工作温度: 1100°C · 炉体加热速率 $\leq 10^{\circ}\text{C}/\text{min}$
加热区	<ul style="list-style-type: none"> · 400mm · 在进行薄膜生长之前, 您应针对自身应用测量炉内温度分布情况
炉管	<ul style="list-style-type: none"> · 石英管 · 尺寸: 100 外径 x95 内径 x1000L(mm)
温度控制 	<ul style="list-style-type: none"> · 包含两个温度控制器。一个用于控制炉温, 另一个用于显示可移动坩埚的温度。 · 通过固态继电器实现 PID 自动控制, 具有 30 步可编程功能。 · 内置超温保护和热电偶故障保护功能。 · 可选: 通过安装控制模块, 可在 PC 上操作该炉。请额外订购 MTS02-B 控制模块。
密封法兰&坩埚移动 	<ul style="list-style-type: none"> · 左边法兰 · $\Phi 100\text{mm}$ 个带 $\Phi 6.35\text{mm}$ 卡套接头的法兰, $\Phi 6.35\text{mm}$ 馈通 (用于插入热电偶), 以及一个 KF40 真空接口 (用于连接真空泵) · 右边法兰 · $\Phi 100\text{mm}$ 的快接法兰, 连接了磁耦合器推杆 · 真空磁耦合推杆杆会固定一个带有石英热缓冲层的石英坩埚, 它能够手动推动坩埚在炉管内移动以实现样品的快速加热或冷却 · K 型热电偶位于坩埚底部, 用于控制温度 · 可选: 如果需要电动推动, 可购买前提出, 本公司可提供, 需额外费用
真空度 	<ul style="list-style-type: none"> · 配有一台涡旋分子泵 · 真空度: 10^{-6}torr (冷态)